

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 11 月 10 日 (2005.11.10)

【公開番号】特開 2003-183294 (P2003-183294A)

【公開日】平成 15 年 7 月 3 日 (2003.7.3)

【出願番号】特願 2002-318109 (P2002-318109)

【国際特許分類第 7 版】

C 07 F 9/32

C 09 K 21/12

【 F I 】

C 07 F 9/32

C 09 K 21/12

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 9 月 26 日 (2005.9.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

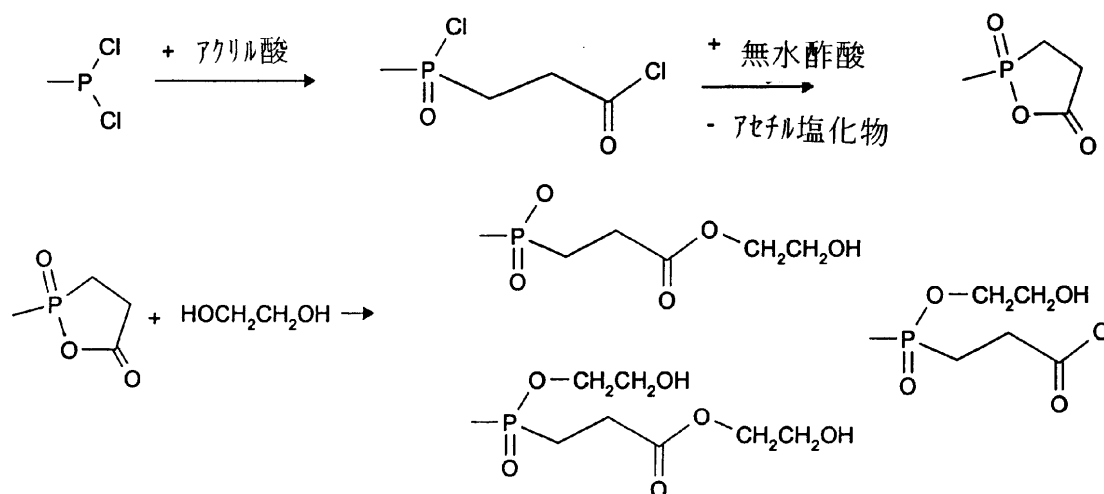
【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

【化 2】



反応式図 1：カルボキシエチルメチルホスフィン酸グリコールエステルの製造

(米国特許第 4,062,888 号明細書またはドイツ特許第

2,529,731 号明細書に従う)

ホスフィン酸エステルは、1-オレフィンに過酸化物触媒の存在下に亜ホスホン酸モノエステルを付加することによって得られる。しかしながらその収率は僅かなものでしかない。触媒としてのアルコキシドの存在下では、活性化二重結合への亜ホスホン酸モノエステルの付加反応はより良好に進行する。適する不飽和化合物は、
 - 不飽和カルボン酸エステルまたは、
 - 不飽和カルボン酸ニトリル、
 - 不飽和ケトンおよびアルキルビニルスルホン類および酢酸ビニルがある (Houben-Weyl、第 12/1 巻、第 258-259 頁)。